## n/i 型 a-Si:H層が p/i 層に部分的に重なった構造の 裏面電極型へテロ接合 Si 太陽電池の特性シミュレーション

2-Dimensional Simulation of Interdigitated Back Contact Silicon Heterojunction Solar Cells in which n/i-type a-Si:H Films Partially Overlap p/i-type Films

福島大 共生システム理工学類<sup>1</sup>, 東海大工<sup>2</sup>, 産総研 再生可能エネルギー研究センター<sup>3</sup> <sup>○</sup>野毛 宏<sup>1</sup>, 齊藤 公彦<sup>1</sup>, 佐藤 愛子<sup>1</sup>, 金子 哲也<sup>2</sup>, 近藤 道雄<sup>1,3</sup>

Fukushima Univ.<sup>1</sup>, Tokai Univ.<sup>2</sup>, AIST<sup>3</sup> °H. Noge<sup>1</sup>, K. Saito<sup>1</sup>, A. Sato<sup>1</sup>, T. Kaneko<sup>2</sup>, M. Kondo<sup>1,3</sup> E-mail: noge.hiroshi@aist.go.jp

【はじめに】 現在幅広く普及している結晶シ リコン(Si)太陽電池の中でも、最近 25% を越え る変換効率で裏面接合型ヘテロ接合太陽電池 が大いに注目されている。我々はこの太陽電池 を作製する際、低コスト化を目指し、pおよび n 領域のパターニングに一般的に用いられる フォトリソグラフィー法ではなく、インクジェ ット印刷によるレジスト塗布を用いたパター ニング法を開発している[1]。構造的には、一 般的に裏面全体に i型 a-Si:H 層を堆積した後、 部分的にp型とn型の層を交互に配置するのに 対し、プロセスの簡便化のため、p/i 層を堆積 した後、それを部分的にエッチングし、一部が 重なるように n/i 層を配置して結晶 Si 表面が露 出しない電極構造とした。この太陽電池の特性 について、構造を最適化するため、2次元のデ バイスシミュレーションを行なった。

【計算】シミュレーションには、SILVACO 社の ATLAS を用いた。ユニットセルの代表的な構造を図 1 に示す。表面のテクスチャは考慮していない。物性パラメータは、主として文献[2] によった。

【結果】図 2 に、変換効率の n/i 層と p/i 層の 重なり幅に対する変化を、重なり幅がゼロの場 合に対する相対値として示す。結晶基板の厚さ が薄いほど、重なりにより効率が低下しやすい ことがわかる。一方、n/i 層や p/i 層それぞれの 幅の違いに対しては、効率はあまり変化しない ことがわかった。

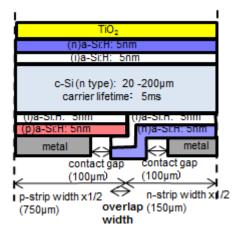


図1. シミュレーションのユニットセル構造

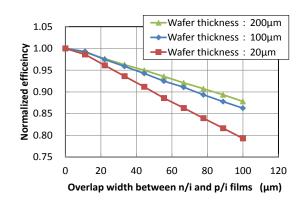


図 2. 各種 Si 基板厚さについて、n/i 層と p/i 層の重なり幅に対する変換効率の相対変化

【謝辞】本研究は、文部科学省地域イノベーション戦略支援プログラムの下で実施されました。

【参考文献】[1] 金子、佐藤、野毛、齊藤、近藤、電子情報通信学会論文誌 **J97-C**, 227-228 (2014).

[2] D. Diouf, J.-P. Kleider, and C. Longeaud, "Physics and Technology of Amorphous-Crystalline Heterostructure Silicon Solar Cells" (W.G.J.H.M van Stark and K. Roca (eds.), Springer Verlarg, Berlin, 2012), Chap. 15.